

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 04022118 A

(43) Date of publication of application: 27.01.92

(51) Int. CI

H01L 21/027

(21) Application number: 02125377

(71) Applicant

CANON INC

(22) Date of filing: 17.05.90

(72) Inventor:

NAKANO KAZUSHI

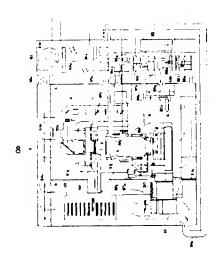
(54) SEMICONDUCTOR ALIGNER

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the precision deterioration an aligner caused by temperature change, by dividing parts into independent spaces, and performing independent air conditioning for each of the spaces.

CONSTITUTION: In a space A, the air from a cooler 81a in a machine chamber is adjusted at a specified temperature by a reheater 82a, and supplied to the space A through a cleaning filer 84a. The air in the space A is returned to the machine chamber by a duct 89a. Thus clean air is always supplied to the space A. Temperature is measured by a temperature sensor 85a, and the cooler 81a and the reheater 82a are controlled by a temperature controller 83. To a space B and a space C, the clean air subjected to independent temperature adjustment is always supplied in the same manner as the case of the space A. To a space D, the clean air which is branched from the space A and subjected to temperature adjustment is supplied.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio



⑩ 日本 国 特 許 庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-22118

Dint. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月27日

H 01 L 21/027

2104-4M 2104-4M

H 01 L 21/30

301 H 3 1 1 L

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全7頁)

半導体露光装置 会発明の名称

> 頁 平2-125377 ②特

> > 志

顧 平2(1990)5月17日 ☎出

危発 明 者 野 神奈川県川崎市中原区今井上町53番地 キヤノン株式会社

小杉喜葉所内

キャノン株式会社 の出 夏 人

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

外1名 弁理士 伊東 哲也 60代理人

1. 発明の名称

半導体器光裝置

- 2. 特許請求の範囲
- (1)チャンパ内に、照明光学系と、露光すべ きパターンが形成されたレチクル保持機構と、投 影レンズ系と、前記パターンを露光転写するウエ ハ保持機構と、レチクルとウェハとの位置合わせ 機構と、レチクル貯蔵搬送機構とを借え、餃チャ ンパを複数の空間に分割し、各空間を該チャンパ 外部に設けた各々別系統の空襲手段に遠道させた ことを特徴とする半導体露光整置。
- (2)前記空間手段は治却器および再然器を有 し、各系統ごとに温度検出手段を設け、検出温度
- 作記数の工業体質半分量
- (3) 他却器を複数系統の空間手段に対し共通 に用いたことを特徴とする特許請求の範囲第1項 工事工程业务集

- (4)前記投影レンズ系を1つの別系統の空間 手段に進通させたことを特徴とする特許請求の範 图第1項記載の半導体器光装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明はIC、LSI等の半導体集子の製造に 使用される露光装置に関し、特に繰り返し露光要 置(スティバ)を対象とし、その重ね合せ性能 (アライメント) 肉上のための塩調機構に関する ものである.

[従来の技術]

半導体装置(素子)は近年ますます微細化、高 集積化されている。 微細化を進める D·RAM (ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ)

256K・DRAM時代に開発されたステッパ

における主力機種である。

撤組化については、重ね合わせ精度が解像力と同等に重要であり、その要求精度は解像力の 1/3~1/5程度とされている。

重ね合わせ精度は大きく2つの要素に分離できる。1つはアライメント成分であり、もう1つは倍撃、ディストーション成分である。

圏特性曲線をで見立え、いめ、エキングの スキットのこれける非異光でライメントングラ 1 東東学教でする。

. .

わせにおいて間接額是因子が多くまたアライメントから露光に至る時間および移動距離が長いため、餌差成分の経時変化が大きく、高い重ね合わせ精度が摂られない。

一方解像力の方は(Remaxx(入される)となるレイリーの式に基づき、露光波長を訓練(436nm)に固定したまま投影レンズの間上を回開した。しかしこれもレイリーの式(DOFmaxx)で明らかなようにNAかりで明らかなようにNAの増加と共進を見るといる。では変光を見いるのではない。現在主線(365nm)を光源をはない。現在主線(365nm)を光源を引きない。現在主線(365nm)を光源を見いて、245nm)を光源とするエキシマステッパが開発されている。

しかしKrFエキシマレーザ(2 4 8 n m)の 光を通す确材は、わずかに石英とホタル石に限られており露光液長以外の光に対する色収差補正が 設計上で非常に困難である。

ントシステムの前述の欠点に対する改良業が本出 顧人による特顧昭 6 3 - 1 1 5 5 3 4 号等で提案 されている。

一方、前述の倍率、ディストーション成分は主として投影レンズの性能に係わる問題であり、この経時変化は投影レンズの置かれる環境の経時変化かその主たる銭差要医である。

これは、空気の大気圧および湿度の変化により 空気の住折寒が変わること、湿度変化によりレン 式硝材の圧折率が変わること、およびレンズ銀筒 の熱色強によるレンズの空気間隔が変わることに 起因している。またこれは、投影レンズの焦点位 量変化を引き起こすことでもよく知られている。

第3回に従来のステッパの構成を示す。 しはす

نسان بول ناسا

を辞明するとき、投影レンズ4によりレギタルよ のと々=1 をウエル上の感光層に転写することが

. .

上方に向けられた光東は、フライアイレンズ33、コンデンサレンズ34 m. 34 b. ミラー35を経てマスキング結像面に至る。36 はマスキングブレードであり、37 m. 37 b はマスキングゼレードである。

レクタとして動き、結像面74の空中像をCCD79の受光面に投影する。25は不図示の光準から光を導く光ファイバであり、照明レンズ26、ピームスブリッタ73を介して声がの光を導体であり、照明レンズ28を介して基準マーク70を照明する。ピームスブリッタ75は、岩準マーク70のパターン面と結像面74が同じ光路長となるよう配置されており従ってこり79の受光面に投影結像される。

チャンバ B 内では、 機械 蓋 B O 内にある 治却録 8 1 m および 再然ヒータ 8 2 m により 進度調節された空気が、 送風機 B 5 m により 単数または複数でする。

る。制な回路9は前近の各様広要素をコントロールであために用いられる。CPU91は定められ

れぞれに截置されており、レーザ干渉点長費 5 8 からのビームを反射することでウエハステージの位置や走行距離を知ることができる。 5 9 は光信号を電気信号に変換するレシーパである。

レチクル1の上側にはレチクル光学系 6 が配置される。レチクル光学系は 2 本の対称レンズ系 6 0 を持つ双眼の光学系であり、レチクル上のターゲットマークを C C D 6 1 で観察することにより、レテクルの位置すれ量を検出することを可能にしている。

し、また各要素からのデータを判断して次の手順を決める。損算回路92は主にステージ座標本オファクシス類散鍵の検出結果など高速性と高速性を要求される損算処理に用いられる記憶であるためには、またチャック・エンの配置され、より、大力の配置され、より、大力のでは、は、アウルの配置され、より、大力のでは、は、アウルのでは、は、アウルのでは、は、アウルのでは、ない、アウルのでは、アウルをは、アウルのでは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウルのでは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウルをは、アウスでは、アウスでは、アウスでは、アウスでは、アウスでは、アウスでは、アウスでは、アウスでは、アウスでは、アウスでは、アウスでは、アウスでは、アウスを関係を表します。アウルを表し、アウスを表しまして、アウルを表します。アウルを表しまして、アウルを表します。アウルを表しまする。

(発明が解決しようとする課題)

マガライスキーでは ジャド へよさい空間用をより、8 エスケリー 本体を下れたといっと、空間的な過度もらは避けられない。 空気は、下波に行くに従って点在する発熱原の影響を受け、進度上昇とともに対流による揺らぎが 発生し、その進度安定性も劣化する。

実際に計測したところでは、精神フィルタ出口で23 で±0.03 でに温調された空気が、下流では2 4 で±0.5 でにも劣化した。また空気の上波で発生したごみが、下流に行くにつれて集積され、空間の精神度を悪化させる。

[護題を解決するための手段および作用]

前記目的を追放するため、本発明は環境の空間的な温度ムラや時間的な温度安定性が、重ね合わせ精度に大きく影響する各部分を個々の独立した空間として仕切り、これら独立した個々の空間をそれぞれ独立して空間することにより、これら個々の空間の温度制御精度を向上させる。

[英茂例]

の 変せる 5 集えり 5 概葉

e c は機械蓄 B O て温度関節された空気をチャン ア B 大に供給する供給ダクト、 B 9 a 、 B 9 b よる基準ミラー 5 7 の位置変化等の製造成分が含まれている。 熱能強による製造量は、対象となる部材の材質が低影強合金網の場合で 2 p p m // で、アルミナセラミックスの場合で 7 p p m // であり、これら部材の長さが 2 0 0 m m の場合には、その影張量はそれぞれ 0 . 4 μ m // で、1 . 4 μ m // でとなり、要求されるアライメント精度に対して無視できない値となる。

また投影レンズ 4 の性能にしても、例えば石英 朝材の過度に対する圧折率変化は、1 5 . 3 × 1 0 - 4 / でであり、この値は投影レンズの個々の性質により変わってくるが、焦点位置変化としては 4 ~ 8 μm / でに相当し、倍率やディストーションも大きく変化する。

以上のことより、従来のチャンパによる空間方式では安定した重ね合わせ精度を得ることは出来す、むしろ劣化させるという欠点があった。

本発明は上記従来技術の欠点に能みなされたものであって、温度変動による露光装置の精度劣化を防止した空間方式の提供を目的とする。

80に戻すりターンダクトである。

この構成においてチャンバ8の内部空間は分離登87a、87b、87cにより、レチクル(またはマスク)ステージ11やレチクル光学系3や露光光濃30が配置されている空間Aと、ウエハステージ5やオファクシ影にではないの空間Cと、レチクルが顕立れている空間Cと、レチクルが近近でリー1CCやレチケル搬送系120か配置されている空間Dにそれぞれ分離されている。

空間人においては、機核室内に配置されている 他却替81gで他却された空気が再熱ヒータ82

. No. 1 of the state of the s

~ 5 8 9 a により空間 A 内の空気が根核変へ戻されることにより、温度調節された情様な空気が空

される空気は、温度センサ85mにより温度計能 され、その空気温度が所定の温度に保たれるよ う、進度コントローラ83により冷却替818の 拾却力や再熟着82mの再熟着が制御されてい る。 空間 B および空間 C においても空間 A と同様 に、それぞれ独立して温度調節された清浄空気が 常時供給されている。また、温度センサ85bは 空間Bに供給される情帯空気の温度を、 温度セン サ85cは空間Cに供給される清神空気の温度を それぞれ針捌し、それらの空気温度がそれぞれ所 定の温度に保たれるよう、温度コントローラ 8-3 により供給される情浄空気の温度が制御されてい る。 空間 D においては、空間 A に供給される空気 が滑掛フィルタ84aの手前で分岐され、滑掛フ ィルタ540を発で空間なに温度電影された情等 空気が供給される。そしてリターンダクト89d により空間D内の空気が機械富80に戻される。

空間チャンパをこのように構成することにより、チャンパ内の空間を積浄に保つとともに、ス チッパ各部に点在する熱源の影響を最小限に押

の進度をチャンパ内のほかの空間とは別に個々に独立制御することにより、チャンパ内の立然である。 大きな ので 点 在 を が の 影響を 最小限に押え、 高精度な 進度制 が できる 空間内の空間的 進度 ムラを 小 で 空 間を 高特度に 進度制 都することが 可能となる。

また本発明によれば、チャンパ内の対離した各 空間をそれぞれ別々の設定温度に刺繍することが 可能であり、投影レンズを囲む分離空間以外の空間 間の温度をチャンパおよび機械室が置かれる空間 の温度と同一にすることができ、温度刺繍に費や されるエネルギを小さくすることも可能となる。 これは投影レンズの性能が、投影レンズが製作さ

三型三线用点的电

第1回は本発明の一実施係の構成区、

- 第2回は本発明に係るチャンパ機械室の他の実 3-1-1-1-1-1-1-1 え、空間 A、空間 B、空間 C それぞれの空間内の空間的温度ムラは小さくなり、また時間的温度を定性も高くなり、所定の空間を高精度に温度制御することができる。また、各空間を分離する分離登87a、87b、87cに断熱材料を使用すれば、各空間間の熱の接受が抑えられ、所定の空間の温度を更に高精度に制御することが可能となる。

機械室の別の構成を第2図に示す。この実施例では、第1図で示した冷却器81b、81cを一つの冷却器81cに置き換え、再熱ヒータ82b、82cにより空間8および空間Cをそれぞれ独立に温度制御する。このようにすれば機械室の容積を小さくすることができる。機械室の構成は盆米器屋の構成、温度条件等に応じて各種変更可能である。

[発明の効果]

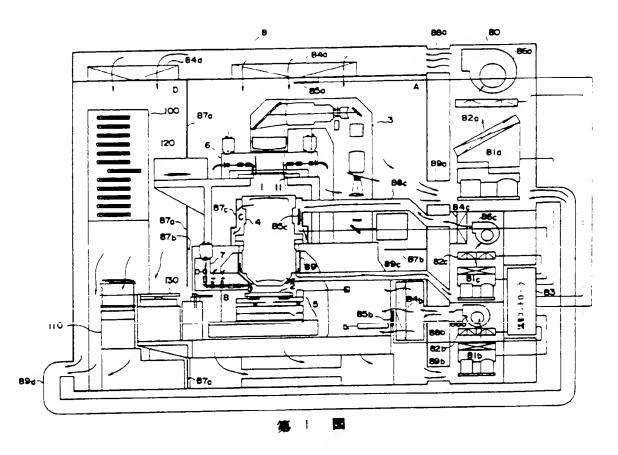
以上説明したように、チャンバ内の空間において高精度な温度制御が必要とされる空間を傷々に分離し、この傷々に分離した空間に供給する空気

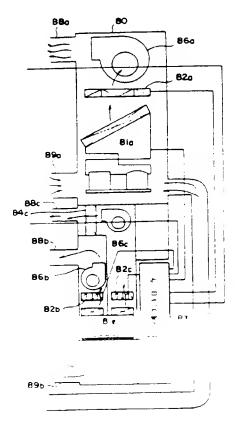
第3回は従来の露光装置の構成図、

第4回(m)、(b)はm線レンズとエキシマレンズの特性曲線の説明図である。

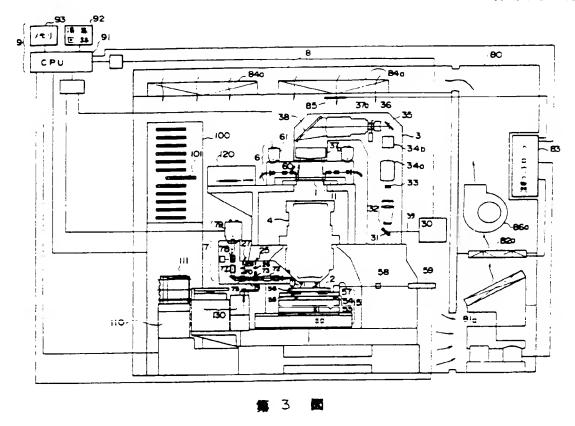
- 1:レチクル、2:ウエハ、3:鮮明光学系、
- 4%投影レンズ、5・ウエハステージ、
- 6 レチクル顕微鏡、
- コーオラフクシス類微鏡、8、チャンパ、
- 8 C 极扬宝。

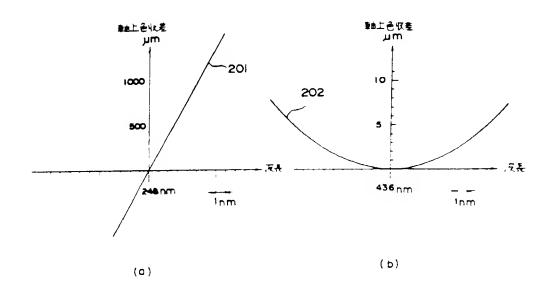
特許出願人 キヤノン株式会社





第 2 图





۶.